

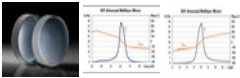
[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

Miroir Concave Multicouches EUV/XUV Attosecondes, 25,4 mm de dia. x 500 mm EFL, 19 nm (65 eV), 5°

See More by [UltraFast Innovations \(UFI\)](#)



UltraFast Innovations (UFI) EUV/XUV Attosecond Multilayer Mirrors



Stock **#16-767** 2 In Stock

-

1

+

€2.520⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€2.520,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

	Type:
Concave Mirror	
	Durée d'Impulsion Compatible:
330 attoseconds	

XUV65BW6	Numéro de Modèle:
Propriétés physiques et mécaniques	
25.40 ±0.13	Diamètre (mm):
Commercial Polish	Surface Arrière:
80	Ouverture Utile (%):
Fine Ground	Bords:
<1	Rugosité de Surface (Angstroms):
6.35 ±0.20	Épaisseur au Bord ET (mm):

Propriétés optiques	
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: □
Rs > 38% @ 65eV/19nm	Spécification du Traitement:
EUV Multilayer (19nm)	Traitement:
5	Angle d'Incidence (°):
19	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
500.00	Distance Focale EFL (mm):
1,000.00	Radius of Curvature (mm):
1,000.00	Rayon R ₁ (mm):
λ/10	Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
>38	Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%):

Electrical	
65 ±2	Énergie Centrale (eV):
6	Largeur de Bande (eV):

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 235:

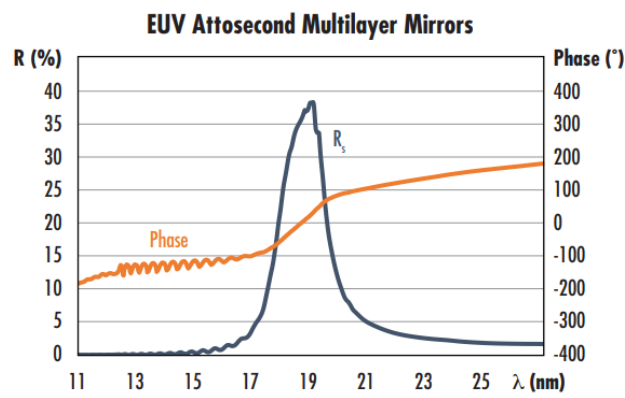
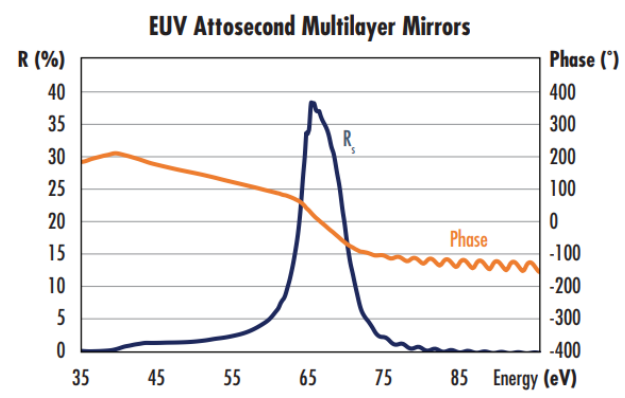
Description produit

- Conçus pour des impulsions de 330 attosecondes à 65 eV (19 nm)
- Traitement multicouches avec une réflectivité maximale de 38%
- Substrats superpolis d’une rugosité de surface ≤1 Å (angström)
- [Miroirs Plans Ultraviolets Extrêmes](#) et [Miroirs Sphériques Ultraviolets Extrêmes](#) conçus à 3,5 nm également disponibles
- Disponibles en stock
- Pas de quantité ou de valeur minimum de commande

Les Miroirs Multicouches Attosecondes pour l’Ultraviolet Extrême (EUV/XUV) d’UltraFast Innovations (UFI) sont conçus pour diriger, focaliser et modeler les impulsions attosecondes. Leur traitement multicouche est centré à 65 eV (19 nm) avec une largeur de bande de 6 eV (1,8 nm) et fournit un pic de réflectivité de 38% pour la lumière polarisée s. Ces miroirs supportent des impulsions EUV d'une durée de 330 attosecondes. Les Miroirs Attosecondes pour l'Ultraviolet Extrême (EUV/XUV) sont idéaux pour générer et modeler des impulsions attosecondes basées sur la génération d'harmoniques élevées (HHG), les lasers à électrons libres (FEL) ou d'autres applications optiques quantiques.

Le dépôt par faisceau d'ions de précision atomique permet d'obtenir des couches de traitement atomiquement lisses. Ces miroirs permettent un contrôle précis de la longueur d'onde et de la phase spectrale avec une efficacité élevée dans une gamme croissante d’applications. La science de l'attoseconde repousse les limites des lasers ultrarapides, donnant accès à certains des processus scientifiques les plus fondamentaux, comme le mouvement des électrons. Les miroirs EUV sont également connus sous le nom de miroirs XUV/rayon X doux. Le principe physique qui sous-tend les miroirs multicouches attoseconde EUV est l'interférence du rayonnement EUV réfléchi et dispersé par chaque interface de la pile multicouche. Des miroirs plats et concaves d'un diamètre de 25,4 mm sont disponibles. Veuillez nous contacter si votre application nécessite un Mroir Multicouche EUV avec une énergie centrale, une largeur de bande ou d'autres spécifications personnalisées.

Informations techniques



Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos [Ressources de nettoyage des optiques](#) pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, [envoyez-nous un e-mail](#) ou [discutez](#) avec notre équipe d'assistance technique.



Outils de Manipulation de Composants

Montures compatibles